

**SEMINAR:  
Plasma-Prozess-Technologie****am Mittwochabend, den 15. März 2023 /  
in Berlin-Adlershof****um 19:00 Networking-Abendessen  
Restaurant Wandel**  
Eisenhutweg 118  
14289 Berlin-Adlershof**am Donnerstag, den 16. März 2023  
in Berlin-Adlershof****Veranstaltungsort des Seminars:  
SENTECH Instruments GmbH**  
Schwarzschildstr. 2, Berlin-Adlershof  
Tel.: +49 30 6392 - 5520**SEMINARPROGRAMM****09:00 Begrüßung, Vorstellung der SEMINAR-Agenda, Organisation und SENTECH Personen**  
Friedrich P. Witek, SENTECH GmbH, Krailling und SENTECH Instruments GmbH, Berlin**Ätztechniken:****09:10 SENTECH Plasma Process Technology – an insight into AlScN and diamond etching**  
Marcel Schulze, SENTECH Instruments GmbH, Berlin  
Friedrich P. Witek, SENTECH GmbH, Krailling und SENTECH Instruments GmbH, Berlin**09:40 Chlorine based ICP etching of III/V-semiconductors for different applications**  
Christoph Meschenmoser, United Monolithic Semiconductors GmbH (UMS), Ulm**10:10 Kaffeepause und Diskussion****10:45 Low damage ALE etching of nitride semiconductors**  
Christian Miersch, Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB,  
Außenstelle THM, Freiberg**11:15 Various laboratory applications of ICP-RIE e.g. for metal etching**  
Thomas Werner, Fraunhofer-Institut für Elektrische Nanosysteme (ENAS), Chemnitz**11:45 Process monitoring and end point detection using various optical in situ metrology**  
Marco Volleth, SENTECH Instruments GmbH, Berlin**12:15 Mittagessen und Diskussion****Beschichtungstechniken:****13.45 PEALD Abscheidung von supraleitenden NbN Schichten / PEALD of superconducting NbN films**  
Marion Hagel, Jürgen Weis, Max-Planck-Institut für Festkörperforschung (MPI-FKF), Stuttgart**14:15 Plasma Enhanced ALD growth of high-k dielectrics for power electronics**  
Raffaella Lo Nigro, CNR-IMM Institute for Microelectronics and Microsystems, Catania, Italien**14:45 Kaffeepause und Diskussion****15:20 ALD and PECVD passivation of Supracon devices**  
Katja Peiselt, Supracon AG, Jena**15:50 ICPECVD: insights into stress control, achieving repeatability in thickness and refractive index,  
and the impact of gas chemistry on films**  
Xuemei Wang, SENTECH Instruments GmbH, Berlin**16:30 Alle Teilnehmer des Seminars sind zum Besuch der Applikationslabore bei SENTECH Instruments  
eingeladen****17:30 Ende des Seminars**